——— НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ ———

УДК 620.18

# СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ИЗНОСО- И ЖАРОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ В СИСТЕМЕ Мо-Y-Zr-Si-B, ПОЛУЧЕННЫХ НА МОЛИБДЕНЕ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПЫЛЕНИЯ В РЕЖИМАХ DCMS И HIPIMS

© 2023 г. Ф. В. Кирюханцев-Корнеев<sup>*a*, \*, Ф. И. Чударин<sup>*a*</sup>, Р. А. Вахрушев<sup>*a*</sup>, А. Д. Сытченко<sup>*a*</sup>, М. И. Карпов<sup>*b*</sup>, Р. Feng<sup>*c*</sup>, Е. А. Левашов<sup>*a*</sup></sup>

<sup>а</sup>Университет науки и технологий "МИСИС", Ленинский проспект, 4с1, Москва, 119049 Россия <sup>b</sup>Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук, ул. Академика Осипьяна, 2, Черноголовка, 142432 Россия <sup>c</sup>China University of Mining and Technology, Xuzhou , 221116 China \*e-mail: kiruhancev-korneev@yandex.ru Поступила в редакцию 18.05.2023 г. После доработки 20.06.2023 г. Принята к публикации 22.06.2023 г.

Покрытия Мо-(Y, Zr)-Si-В были получены методами магнетронного напыления постоянного тока (DCMS, direct current magnetron sputtering) и высокомошного импульсного магнетронного напыления (HIPIMS, high power impulse magnetron sputtering) с использованием композиционных мишеней  $MoSi_2 + 10\%$  MoB и ( $MoSi_2 + 10\%$  MoB) + 20% ZrB<sub>2</sub>, с расположенными в их зоне эрозии сег-ментами Y суммарной площадью 5 и 10 см<sup>2</sup>. Структура и состав покрытий исследовались методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда и рентгенофазового анализа. Были определены твердость, модуль упругости, упругое восстановление, адгезионная прочность, стойкость покрытий к ударным циклическим и абразивным воздействиям. Жаростойкость и термическая стабильность оценивалась при нагреве покрытий до максимальной температуры 1000°С в муфельной печи и в колонне просвечивающего электронного микроскопа, соответственно. Установлено, что основу покрытия Mo-Si-B составляет фаза h-MoSi<sub>2</sub> с текстурой в направлении [110] и размером кристаллитов 75 нм. Легирование покрытий Zr и Y, а также переход от DCMS к режиму HIPIMS, способствовали подавлению преимущественного роста кристаллитов, повышению их дисперсности и объемной доли аморфной фазы, что приводило к повышению трещиностойкости и адгезионной прочности покрытий. Применение метода HIPIMS при осаждении покрытий вызвало рост твердости и модуля упругости на 10%, стойкости к циклическим ударным воздейстивмя на 60%, абразивной стойкости на 20%, увеличению жаростойкости до 20%. Покрытия Мо-Y-Zr-Si-В оптимального состава обладали высокой термической стабильностью, — основная структурная составляющая, гексагональная фаза h-MoSi<sub>2</sub>, сохранялась в температурном диапазоне 20-1000°C, а также обеспечивали повышение жаростойкости Мо подложки более, чем в 9 раз при 1000°С.

DOI: 10.31857/S0044185623700687, EDN: PPRIPC

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Молибден является одним из основных материалов для высокотемпературных применений [1, 2]. Главным недостатком, ограничивающим использование молибдена, является его интенсивное окисление при нагреве на воздухе до температур 400–700°С с образованием газообразного оксида MoO<sub>3</sub>, ведущим к ускоренному разрушению изделий [2]. Для защиты молибденовых сплавов широко используются жаростойкие покрытия на основе  $MoSi_2$  [3–5]. Хорошо известно, что высокая стойкость  $MoSi_2$  к окислению обусловлена образованием защитного слоя  $SiO_2$ вследствие частичного окисления Si. В то же время при температуре 500°С все еще продолжается нежелательное окисление Mo [6]. Это в первую очередь вызвано растрескиванием силикатного слоя. Чтобы выровнять коэффициенты термического расширения и повысить способность покрытия к самозалечиванию в состав вводится бор [7, 8]. Покрытия MoSi<sub>2</sub>, легированные бором, имеют повышенную рабочую температуру на уровне 1100-1400°С. Улучшить характеристики объемных материалов и покрытий Mo-Si-B можно путем введения в их состав тугоплавких металлов, таких как Hf, Zr, Ti и т.д. [8-10]. В работе [9] было показано, что легирование покрытий Mo-Si-В гафнием и цирконием приводит к снижению размера зерен основной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub> с 20 до 10-15 нм, увеличению доли аморфной составляющей (а-МоВ), повышению стойкости к растрескиванию при нагреве, росту жаростойкости на 10-30% при температуре 1000°С и на 40-70% при 1500°С. Высокая жаростойкость покрытий Mo-Zr-Si-B связана с образованием многослойной поверхностной оксидной пленки соста- $Ba SiO_2 + ZrO_r [9].$ 

Перспективным является введение в состав покрытий Mo-Si-В редкоземельных металлов. Добавление 0.5% La в состав покрытия Mo-Si-B приводит к образованию по границам зерен оксида La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, тормозящего диффузию кислорода вглубь покрытия при высокотемпературном нагреве, а также способствует повышению трибологичеких характеристик материала [11]. Легирование покрытия Mo-Si-B иттрием позволило повысить стойкость покрытий на подложках из никелевых сплавов к циклическим ударным воздействиям на 50% [12]. Иттрий-содержащие композиционные покрытия на основе Mo-Si-В успешно зашишают материал подложки от окисления в среде ионизированного воздуха при 1800-2100°С в течение 100 с [13].

Для нанесения покрытий на основе MoSi<sub>2</sub> применяются: детонационное напыление [14], плазменное или газопламенное сверхзвуковое напыление [15], шликерно-обжиговая технология [16], электролиз расплава солей [17] и электроискровое легирование [18]. Широко используется метод диффузионного насыщения [19, 20], а также способ, комбинирующий осаждение Мо с последующим диффузионным насыщением Si и В [21, 22]. Недостатками указанных методов являются повышенные шероховатость, дефектность и неравномерность покрытий, а также изменение геометрии подложки. В ряде случаев требуются дополнительный отжиг системы "покрытиеподложка" и механическая обработка изделий с точными допусками. Перспективным для получения покрытий из керамических материалов является метод магнетронного напыления, обеспечивающий простоту контроля структурно-фазового состояния, высокое качество и низкую шероховатость покрытий, отсутствие ограничений при выборе материала подложек. сохранение геометрии изделия и относительно высокие скорости осаждения [8, 23, 24]. Применение высокомошного импульсного магнетронного распыления (HIPIMS, high power impulse magnetron sput-

tering) дает дополнительные возможности для улучшения характеристик покрытий [25, 26]. Метод HIPIMS за счет более высокой мощности обеспечивает значительное увеличение плотности плазмы от  ${\sim}10^{10}$  ион/см $^3$  для магнетронного распыления на постоянном токе (DCMS, direct current magnetron sputtering) до 10<sup>13</sup>-10<sup>14</sup> ион/см<sup>3</sup> для HIPIMS [27]. В случае HIPIMS распыленные атомы интенсивно ионизируются во время прохождения через плазму, и поток состоит преимущественно из ионов, а не атомов, как в случае DCMS. Увеличение соотношения ион/атом в потоке, присущее HIPIMS, приводит к значительному повышению адгезионной прочности осаждаемых покрытий за счет образования псевдодиффузионных слоев и эффектов ионной имплантации на этапе предварительного травления поверхности подложки [28, 29].

Целью работы является определение структуры, механических и трибологических характеристик, а также жаростойкости покрытий Мо–(Zr, Y)–Si–B, нанесенных на подложки из молибденовых сплавов методами DCMS и HIPIMS.

## 2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Покрытия Мо-(Y, Zr)-Si-В были получены методом магнетронного напыления с использованием мишеней MoSi<sub>2</sub> + 10% MoB и (MoSi<sub>2</sub> + + 10% MoB) + 20% ZrB<sub>2</sub> диаметром 120 мм и толщиной 10 мм, в зону эрозии (площадь 60 см<sup>2</sup>) которых помещались 2 или 4 сегмента Ү (99.99%) общей площадью 5 и 10 см<sup>2</sup>, соответственно. Мишени изготавливались с применением методов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и горячего прессования. Осаждение покрытий проводилось на модернизированной установке типа УВН-2М, принципиальная схема которой представлена в работе [9], в среде Аг (99.9995%) при давлении 0.2 Па. Остаточное давление составляло  $3 \times 10^{-3}$  Па. Покрытия наносились на пластины молибдена марки МЧ-1 размером 15 × 15 × 5 мм, диски молибденового сплава TCM-7 ( $\emptyset$  30 × 5 мм), фольгу Мо (20 × 10 × 0.1 мм) которые предварительно подвергались ультразвуковой очистке в изопропиловом спирте в течение 5 мин. Дополнительно проводилась ионная очистка (ионы Ar<sup>+</sup>, 2 кэВ, 40 мин) в вакуумной камере непосредственно перед нанесением покрытий. Время осаждения покрытий составляло 40 мин. При нанесении покрытий на Мо подложки со всех сторон в режиме вращения, для последующих отжигов на воздухе, время осаждения было увеличено до 2 ч. Для реализации режимов DCMS и HIPIMS применялись блоки питания Pinnacle+ (Advanced Energy, США) и TruPlasma 4002 (Trumpf, Германия), соответственно. Значения электрических параметров распыления приведены в табл. 1. Было установлено, что в режиме HIPIMS основная электрическая мощность pea-

№	Покрытие	Мишень	$N_{ m Y}$	Метод	<i>U</i> , B	<i>I</i> , A	<i>Р</i> , кВт	<i>I</i> <sub>пик</sub> , А	<i>Р</i> <sub>пик</sub> , кВт
1	Mo-Si-B DCMS		0	DCMS	500	2	1	-	
2	Mo-Si-B + 2Y DCMS		2	DCMS	500	2	1	_	_
3	Mo-Si-B+4Y DCMS	$MoSi_2 + 10\% MoB$	4	DCMS	500	2	1	_	_
4	Mo-Si-B HIPIMS		0	HIPIMS	970	3	1	40	40
5	Mo-Si-B + 4Y HIPIMS		4	HIPIMS	400	2.2	1.9	90	75
6	Mo–Zr–Si–B + 2Y HIPIMS	$(MoSi_2 + 10\% MoB) + 20\% ZrB_2$	2	HIPIMS	840	1.4	1.9	90	75

Таблица 1. Параметры нанесения покрытий

N<sub>Y</sub>-количество сегментов иттрия; U-напряжение; I-ток; P-средняя мощность; I<sub>пик</sub>-пиковый ток; P<sub>пик</sub>-пиковая мощность.

лизуется на сегментах Y, что определяет повышение средней и пиковой мощности (покрытия 5 и 6).

Исследование химического состава покрытий проводилось методом оптической эмиссионной спектроскопии тлеющего разряда (ОЭСТР) на приборе Profiler 2 (Horiba Jobin Yvon, Франция) [30]. Структура исследовалась методами сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (СЭМ и ПЭМ) на приборах S-3400 (Hitachi, Япония) и JEM-2100 (JEOL, Япония), соответственно. Ламели для ПЭМ были получены с помощью механического утонения и последующего ионно-лучевого травления на установке PIPS II (Gatan, США). Размер кристаллитов и межплоскостные расстояния определялись с помощью программного обеспечения ImageJ и Olympus Radius 2.0. Рентгенофазовый анализ  $(P\Phi A)$  проводился на приборе Phaser D2 (Bruker, США) с использованием излучения CuKa.

Адгезионная прочность покрытий определялась методом измерительного царапания на приборе Revetest (CSM Instruments, Швейцария), оснащенном алмазным индентором Роквелла с радиусом закругления вершины 0.2 мм. Для оценки адгезионной прочности методом Rockwell С проводились испытания на твердомере ТР-5006-02 (Точприбор, Россия) при нагрузке на индентор 1471 Н. Для исследования механических свойств методом наноиндентирования использовался нанотвердомер Nano-Hardness Tester (CSM Instruments, Швейцария); нагрузка на индентор Берковича составляла 4 мН. Исследование трещиностойкости покрытий проводилось с использованием микротвердомера HVS-50, оснащенном индентором Виккерса, при нагрузке 10 и 50 Н. Ударные циклические испытания осуществлялись на приборе Impact Tester (СетеСоп, Германия). Образцы подвергались 10<sup>5</sup> ударам твердосплавным шариком (Ø 5 мм) с частотой 50 Гц и нагрузкой 100 Н. Абразивная стойкость покрытий исследовалась на установке типа Calowear-tester (НИИ-ТАвтопром, Россия). В качестве контртела использовался шарик из стали ШХ15 (Ø 27 мм). Скорость вращения шарика составляла 13 об./мин, нагрузка – 1.8 Н, абразив - алмазная суспензия (1 мкм) (Struers, Дания). Время абразивного воздействия составляло 3, 5 и 7 мин. Анализ поверхности образцов в зоне трибоконтакта после испытаний проводился с использованием оптического профилометра NT1100 (WYKO, США), оптических микроскопов Neophot 21 и Axiovert 5 (Carl Zeiss, Германия).

С целью определения жаростойкости. покрытия отжигались в изотермическом режиме на воздухе при температуре 1000°С в течение 1 ч в муфельной печи SNOL-7.2/1200. Для оценки термической стабильности были проведены in-situ исследования структурно-фазовых превращений. происхоляших при нагреве ламелей покрытий в колонне ПЭМ. Нагрев до температур 400, 600, 800, 900 и 1000°С со скоростью 100°С/мин осуществлялся с использованием держателя Gatan 652. Выдержка при каждой температуре составляла 10-30 мин. Также проводились вакуумные отжиги покрытий в печи "Термоник Т1" при температурах 600. 800 и 1000°С и выдержке 10 мин, что близко к режимам нагрева в колонне ПЭМ. Скорости нагрева и охлаждения составляли 15°С/мин.

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

### 3.1. Состав и структура

Все полученные покрытия характеризовались равномерным распределением основных элементов по толщине. На рис. 1а представлен типичный элементный ОЭСТР-профиль покрытия Mo-Si-B + 4Y HIPIMS. Усредненный по толщине состав покрытий приведен в табл. 2. Покрытия, полученные с использованием 2 и 4 сегментов иттрия, содержали от 4 и 7 ат. % Ү, соответственно. Содержание остальных элементов закономерно уменьшалось. Покрытие 6, полученное при распылении мишени (90% MoSi<sub>2</sub> + + 10% MoB) + 20% ZrB<sub>2</sub> характеризовалось повышенной концентрацией бора (22 ат. %.), концентрация Zr составляла 9 ат. %. Данные особенности связаны с присутствием в составе мишени фазы ZrB<sub>2</sub>. Было установлено, при использовании метода HIPIMS содержание примесей в покрытиях выше: суммарная концентрация углерода и кислорода для DCMS-покрытий не превышала 4 ат. %, в то время как для HIPIMS-образцов данный пока-



Рис. 1. Элементный профиль (а) и РЭМ-изображение излома (б) покрытия Mo–Si–B + 4Y HIPIMS.

затель находился в пределах 5–10 ат. %. Повышенный уровень примесей объясняется снижением скорости роста покрытий при импульсной подаче мощности [26, 29]. Важно отметить, что примеси могут негативно влиять на поведение покрытий при высокотемпературном нагреве и механические свойства [31, 32].

По данным СЭМ полученные покрытия обладали плотной малодефектной структурой с отсутствием выраженных столбчатых кристаллитов. В качестве примера на рис. 16 представлено типичное СЭМ-изображение поперечного излома покрытия Mo-Si-B + 4Y HIPIMS. Значения толшин и скоростей роста, оцененные на основе полученных микрофотографий изломов покрытий, представлены в табл. 2. Скорость роста покрытия Мо-Si-B DCMS составила 187 нм/мин. При использовании двух и четырех сегментов иттрия скорость роста покрытия Мо-Si-В увеличилась на 17 и 10% соответственно. В случае покрытия Mo-Si-B переход от режима DCMS к HIPIMS привел к снижению скорости роста на 30%, что может быть связано со снижением времени действия прямого импульса, в процессе которого происходит осаждение покрытий [29]. Покрытие Mo-Si-B + 4Y HIPIMS обладало минимальной скоростью роста 70 нм/мин. Скорость роста по-крытия Mo-Zr-Si-B + 2Y HIPIMS составила 168 нм/мин.

Рентгенограммы DCMS покрытий представлены на рисунке 2а. Для всех покрытий выявлялись пики в положениях  $2\theta = 40.5$ , 58.6, 73.6 и  $87.6^{\circ}$ , соответствующие подложке *fcc*-Mo (ICDD) 42-1120). На рентгенограмме покрытия Mo–Si–B наблюдались высокоинтенсивные пики от гексагональной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub> (ICDD 80-4771) с текстурой в направлении [110]. Размер кристаллитов *h*-MoSi<sub>2</sub>, определенный по формуле Шеррера по линии (110), составил 75 нм. Параметры решетки *h*-MoSi<sub>2</sub> для покрытия Mo-Si-B составляли *a* = = 0.460 и *c* = 0.657 нм. Для покрытий Мо–Si– В + 2Y и Mo-Si-B + 4Y, полученных методом DCMS, текстуры *h*-MoSi<sub>2</sub> выявлено не было. В положениях  $2\theta = 22^{\circ} - 32^{\circ}$ ,  $32^{\circ} - 50^{\circ}$  и  $60^{\circ} - 70^{\circ}$ наблюдались уширенные пики, которые можно связать с образованием аморфной фазы. Таким образом, введение в состав 4 и 7 ат. % иттрия приводит к аморфизации покрытия Mo-Si-B. Рентгенограммы HIPIMS-покрытий показаны на рис. 26. Для покрытия Mo-Si-B выраженной

N⁰	Элементный состав, ат. %						Скорость роста,	
	Мо	Si	В	Y	Zr	толщина, мкм	нм/мин	
1	24	68	8	0	0	7.5	187	
2	22	66	8	4	0	8.7	218	
3	30	58	5	7	0	8.2	205	
4	22	70	8	0	0	5.3	133	
5	25	61	7	7	0	2.8	70	
6	14	51	22	4	9	6.7	168	

Таблица 2. Элементный состав, толщина и скорость роста покрытий

\* Толщина рассчитана по результатам теста Calowear.



Рис. 2. Рентгенограммы покрытий, полученных методами полученных методами DCMS (а) и HIPIMS (б).

текстуры выявлено не было: на рентгенограмме наблюдались основные высокоинтенсивные рефлексы h-MoSi<sub>2</sub>, связанные с отражением от плоскостей (100), (110), и (200) фазы h-MoSi<sub>2</sub>. Размер кристаллитов h-MoSi<sub>2</sub>, определенный по линии (110), составил 70 нм, что близко к данным, полученным для DCMS покрытия Mo–Si–B. HIP-IMS-покрытия Mo–Si–B + 4Y и Mo–Zr–Si–B + 2Y имели аморфную структуру аналогичную DCMS-образцам.

На рис. За представлены светлопольное ПЭМ-изображение и электронограмма покрытия Mo-Si-B, полученного методом DCMS. Размер кристаллитов составлял 30-100 нм. На электронограмме покрытия обнаружены отражения. соответствующие межплоскостным расстояниям 0.189 и 0.348 нм, характерным для гексагональной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub>. Также обнаружены рефлексы от тетрагональной фазы *t*-MoB (0.212, 0.125 и 0.174 нм). Покрытие Mo-Si-B + 4Y DCMS содержало мелкие кристаллиты размером 2-4 нм, находящиеся в аморфной матрице (рис. 36). На электронограмме выявлялись: широкое кольцо, свидетельствующее о наличии аморфной фазы, рефлексы с межплоскостными расстояниями 0.305 нм (фаза t-MoB) и 0.222 нм (фаза h-MoSi<sub>2</sub>). Сильное уширение рефлексов кристаллических фаз объясняется их высокой дисперсностью. Прочие покрытия не исследовались методом ПЭМ, поскольку имели структуру с высокой долей аморфной фазы, в целом близкую к Mo-Si-B + 4Y DCMS по данным РФА (рис. 2).

### 3.2. Адгезионная прочность

На рис. 4 приведены зависимости коэффициента трения и акустической эмиссии (АЭ) от нагрузки, двухмерные изображения царапин на поверхности покрытий после измерительного царапания, а также значения нагрузок Lc<sub>2</sub>, при которых начиналось отслоение покрытий [33]. В случае покрытия Mo-Si-В DCMS величина Lc<sub>2</sub> была максимальной и составляла 13.0 Н. При этой нагрузке по данным профилометрии появлялись первые отслоения, а на кривой АЭ начинались колебания значений (рис. 4). Коэффициент трения равномерно возрастал с увеличением нагрузки. Отслоение покрытий Mo-Si-B + 2Y DCMS и Mo-Si-B + 4Y DCMS наступало при достижении более низких нагрузок 9.1 и 11.0 Н, соответственно, что связано с их большей толшиной, а также ростом объемной доли хрупкой аморфной фазы. Отслоению предшествовали всплески значений акустической эмиссии, вы-

Таблица 3. Механические свойства покрытий

N⁰	<i>Н</i> , ГПа	<i>Е</i> , ГПа	H/E	<i>H</i> <sup>3</sup> / <i>E</i> <sup>2</sup> , ГПа	W, %
1	23	320	0.073	0.126	46
2	16	250	0.065	0.070	40
3	17	218	0.078	0.105	43
4	26	348	0.074	0.141	50
5	12	186	0.067	0.056	37
6	18	252	0.073	0.099	45



**Рис. 3.** Светлопольные ПЭМ-изображения и электронограммы покрытий Mo–Si–B DCMS (а) и Mo–Si–B + 4Y DCMS (б).

званные растрескиванием покрытий. В случае Mo-Si-B HIPIMS и Mo-Zr-Si-B + 2Y HIPIMS величина Lc<sub>2</sub> составляла 8.0-8.5 Н. Скачки на кривых АЭ при 25-30 Н свидетельствует о достижении подложки контртелом. Для покрытия Mo-Si-B + 2Y HIPIMS нагрузка  $Lc_2$  составила 5.8 Н. Более интенсивное отслоение иттрий-содержащих покрытий можно связать с ростом внутренних напряжений при введении в состав Ү [34]. Ранее было показано, что У в покрытиях Мо-Si-В внедряется в решетку основной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub>, изменяя ее период [12]. В то же время дополнительное введение циркония в состав иттрий-содержащего покрытия приводит увеличению величины  $Lc_2$  на 40%. Важно отметить, что значения *Lc*<sub>2</sub> как правило достаточно низки при использовании пластичных подложек [35-37] и составляют 5-20 Н.

Микрофотографии поверхности покрытий после индентирования конусом Роквелла представлены на рис. 5. В случае Mo-Si-B DCMS вблизи отпечатка произошло значительное отслоение и последующее вспучивание покрытия. На поверхности покрытия Mo-Si-B + 2Y DCMS наблюдалось слабо выраженные трещины (длиной не более 400 мкм) и отслоения. Для образца Mo-Si-B + 4Y DCMS вспучивания и отслоения по границам отсутствовали, длина радиальных трещин не превышала 300 мкм. Покрытие Мо-Si-B HIPIMS отслоилось от подложки в радиусе ~500 мкм от границы отпечатка. На поверхности покрытия Mo-Si-B + 4Y HIPIMS по границам отпечатка наблюдалось интенсивное формирование радиальных трещины (<300 мкм) без отслоений. Для покрытия Mo-Zr-Si-B + 2Y HIPIMS дефектов по границам отпечатка выявлено не было.

Таким образом, согласно данным теста Rockwell C введение иттрия в состав покрытий, а также переход от DCMS к режиму HIPIMS в случае легированных покрытий способствует повышению адгезионной прочности. Плохая корреляция между тестом Rockwell C и скратч-тестированием может быть связана с тем, что во втором случае величина  $Lc_2$ , которую обычно используют для характеризации адгезионной прочности, напрямую зависит от толщины покрытий [38, 39].

# 3.3. Твердость, упруго-пластические свойства, трещиностойкость

Твердость (*H*), модуль упругости (*E*), упругое восстановление (*W*), индекс пластичности (*H*/*E*) и сопротивление пластической деформации разрушения ( $H^3/E^2$ ) покрытий представлены в табл. 2. Покрытие Mo–Si–B DCMS продемонстрировало значения H = 24 ГПа, E = 320 ГПа, W = 46% и  $H^3/E^2 = 0.126$  ГПа. Увеличение концентрации иттрия с 0 до 7 ат. % привело к снижению твердости на 26%, модуля упругости, упругого восстановления на 32% и сопротивления пластической деформации на 16%. Тем не менее для покрытия Mo–Si–B + 4Y DCMS параметр *H*/*E*, определяющий трещиностойкость материала [40], был максимальным и составлял 0.078.

Наиболее высокие механические свойства имело покрытие Mo–Si–B HIPIMS, которое характеризовалось H = 26 ГПа, E = 348 ГПа, W = 50%,  $H^3/E^2 = 0.141$  ГПа. HIPIMS-покрытия Mo–Si–B + 4Y и Mo–Zr–Y–Si–B HIPIMS продемонстрировали более низкие характеристики, снижение составляло 10–30% (табл. 2). Таким образом, введение иттрия в состав DCMS и HIPIMS покрытий Mo–Si–B приводит к снижению механических характеристик, что может быть связано с ростом объемной доли аморфной фазы. Важно отметить, что переход от режима DCMS к HIP-IMS способствует повышению твердости покрытия Mo–Si–B на 13% и модуля упругости на 9%.

Для предсказания поведения покрытий в условиях трибологического контакта и абразивного воздействия важно исследовать их трещиностойкость [40–42]. На рис. 6 представлены микрофотографии отпечатков после индентирования при нагрузках 10 и 50 Н. При нагрузке 10 Н на поверх-

551



Рис. 4. Кривые зависимости коэффициента трения и акустической эмиссии от нагрузки и двухмерные изображения царапин после скратч-тестирования.



Рис. 5. Микрофотографии поверхности покрытий после индентирования конусом Роквелла.

ности DCMS- и HIPIMS-покрытий наблюдались радиальные и кольцевые трещины по границам отпечатка. При этом интенсивность растрескивания покрытий снизилась при переходе от режима DCMS к HIPIMS.

При нагрузке 50 Н на поверхности DCMS покрытий Mo–Si–B, Mo–Si–B + 2Y и HIPIMS покрытия Mo–Si–B вблизи отпечатка наблюдалось образование радиальных и кольцевых трещин. Причем преобладающим видом разрушения являлись кольцевые трещины, которые могут привести к отслоению покрытий [43]. Для покрытия Mo–Si–B + 4Y DCMS в зоне отпечатка преобладали радиальные трещины. На поверхности по-

#### СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



**Рис. 6.** Микрофотографии поверхности покрытий после индентирования пирамидой Виккерса при нагрузках: (a) 10 H, (6) 50 H.

крытия Mo–Si–B + 4Y HIPIMS наблюдалось образование радиальных трещин и отслоение покрытия по границам отпечатка. Для покрытия Mo–Zr–Si–B + 2Y HIPIMS разрушений обнаружено не было. Рост трещиностойкости при введении иттрия в состав покрытий Mo–Si–B можно связать со снижением размера кристаллитов фазы h-MoSi<sub>2</sub>, образованием нанокомпозионной структуры, состоящей из нанокристаллитов и аморфных областей. Похожее влияние легирующих добавок Hf и Zr на свойства покрытий Mo– Si–B наблюдалось ранее в работе [9, 44]. Наиболее эффективно трещиностойкость повышается при одновременном легировании покрытий Mo– Si–B иттрием и цирконием (рис. 6).

# 3.4. Стойкость к ударному циклическому воздействию

Трехмерные профили поверхности покрытий Мо–(Zr, Y)–Si–В после ударных циклических испытаний при нагрузке 100 Н представлены на рис. 7. Значения диаметров (*d*), глубин (*h*) и объемов (*V*) кратеров, сформировавшихся на поверхности покрытий после тестирования представлены на рис. 8. Для покрытия Мо–Si–В DCMS величины *d*, *h* и *V* составили 450 мкм, 7.29 мкм и  $4.0 \times 10^5$  мкм<sup>3</sup>, соотвественно. Введение 4 и 7 ат. % иттрия приводило к росту *d* в 1.7 раза. Значения *h* и *V* были близки для DCMS покрытий Мо–Si–В и Мо–Si–B + 2Y, в то время как для образца Мо–Si–B + 4Y наблюдалось повышение *h* и *V* в 3 и 7 раза, соотвественно.

Покрытие Mo–Si–В HIPIMS характеризовалось значениями диаметра d = 462 мкм, глубины h = 7.3 мкм и объема  $V = 4.2 \times 10^5$  мкм<sup>3</sup>, что близко к DCMS покрытию аналогичного состава. Введение Y при использовании HIPIMS режима привело к увеличению *d* до 685 мкм, *h* до 8.0 мкм и *V* до  $5.0 \times 10^5$  мкм<sup>3</sup>. Покрытие Mo–Zr–Si–B + 2Y HIPIMS по свойствам почти не отличалось от базового образца Mo–Si–B HIPIMS и характеризовалось значениями *d* = 460 мкм, *h* = 7.8 мкм и *V* = 4.7 ×  $\times 10^5$  мкм<sup>3</sup>. Таким образом, введение иттрия в состав как DCMS-, так и HIPIMS-покрытий Mo– Si–B снижает стойкость к ударным воздействиям, в то время как переход от режима DCMS к HIPIMS в случае образца Mo–Si–B + 4Y позволяет снизить объем кратера на 60%.

### 3.5. Стойкость к абразивному воздействию

Микрофотографии зон абразивного износа покрытий приведены на рис. 9. Значения объемов удаленного материала  $V_a$  представлены на рис. 10. Покрытие Mo–Si–B DCMS при абразивном воздействии в течение 3 минут характеризовалось минимальным  $V_a = 240 \times 10^4$  мкм<sup>3</sup>. Максимальным  $V_a = 412 \times 10^4$  мкм<sup>3</sup> характеризовалось покрытие Mo–Si–B + 2Y DCMS, причем покрытие износилось на всю толщину Покрытие Mo–Si–B + 4Y показало значение  $V_a = 290 \times 10^4$  мкм<sup>3</sup>, близкое к образцу Mo–Si–B DCMS.

В случае покрытия Mo–Si–В HIPIMS  $V_a$  составил 165 × 10<sup>4</sup> мкм<sup>3</sup>, что на 30% ниже данных, полученных для Mo–Si–В DCMS. Введение иттрия в состав HIPIMS-покрытий привело к росту значений  $V_a$  на 30%. Наилучшие результаты были получены при одновременном легировании ит-



Рис. 7. 3D изображения поверхности покрытий после ударных циклических испытаний.



**Рис. 8.** Диаметры (а), глубины (б), и объемы кратеров (в), сформировавшихся на поверхности покрытий после ударных циклических испытаний.

трием и цирконием: покрытие Mo-Zr-Si-B + 2Y HIPIMS характеризовалось минимальным объемом удаленного материала  $85 \times 10^4$  мкм<sup>3</sup>.

С ростом времени абразивного воздействия увеличивались значения  $V_a$  покрытий, при этом все ранее описанные закономерности сохранялись. Таким образом, введение иттрия в состав покрытий Mo–Si–B негативно влияет на абразивную стойкость, тогда как легирование Y и Zr способствует повышению абразивной стойкости покрытий в 2.5 раза при максимальном времени воздействия. Переход от режима DCMS к HIP-IMS способствовал росту абразивной стойкости покрытий на 20–30%.

Стоит отметить, что стойкость покрытий к истирающему воздействию во многом определяется их упруго-пластическими характеристиками [45, 46]. Для покрытий Mo–Si–B, легированных Y, наблюдалась прямая зависимость стойкости к абразивному износу от сопротивления пластической деформации разрушения и упругого восстановления. Примечательно, что максимальная абразивная стойкость наблюдалась для покрытия Mo–Zr–Si–B + 2Y HIPIMS, характеризующегося средними механическими свойствами. Данный эффект может быть связан с повышенной вязкостью и трещиностойкостью данного покрытия [42].

#### 3.6. Жаростойкость и термическая стабильность

Для оценки жаростойкости были проведены изотермические отжиги в течение 1 ч при температуре  $1000^{\circ}$ С непокрытой молибденовой подложки и подложки с покрытиями Mo–Si–B DCMS, Mo–Zr–Si–B + 2Y HIPIMS и Mo–Zr–Si–B + 2Y DCMS, нанесенными со всех сторон. Удельная потеря массы и внешний вид образцов до и после отжигов, элементный профиль подложки и покрытия Mo–Zr–Si–B + 2Y DCMS после отжига при температуре  $1000^{\circ}$ С приведены на рис. 11. В случае непокрытой подложки Мо на-блюдалось интенсивное окисление, сопровожда-

### СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Рис. 9. Микрофотографии зон износа покрытий при длительности абразивного воздействия 3 мин (а) и 7 мин (б).



Рис. 10. Объем удаленного материала покрытий при абразивном воздействии в течение 3, 5 и 7 мин.

ющееся формированием и осыпанием рыхлого оксидного слоя МоО<sub>х</sub> [2]. Удельная потеря массы  $\Delta m/S$  подложки составила 0.66 г/см<sup>2</sup>. Для покрытия Mo-Si-B DCMS эта величина была в 3 раза ниже и составила  $\Delta m/S = 0.21$  г/см<sup>2</sup>. На основной поверхности образца присутствовала плотная пленка, также наблюдались локальные участки разрушения, возникшие в результате диффузии кислорода в месте крепления образца (рис. 11). Покрытия Mo-Zr-Si-B + 2Y, полученные методами DCMS и HIPIMS, сохраняют свою целостность в процессе отжигов и успешно зашишают подложку от окисления. Значения  $\Delta m/S$  для DCMS- и HIPIMS-покрытий Mo-Zr-Si-B + 2Y составили 0.09 и 0.07 г/см<sup>2</sup>, соответственно. Таким образом, комбинированное легирование У и Zr, позволяет повысить жаростойкость покрытий Мо-Si-В в 2-3 раза и обеспечить рост этого показателя относительно непокрытой молибденовой подложки в 7-9 раз,

Элементные профили отожженных подложки и образца с покрытием Мо-Zr-Si-B + 2Y HIP-IMS представлены на рис. 116. Перед съемкой элементных профилей с поверхности образцов механически удалялся рыхлый оксид. Согласно данным ОЭСТР для непокрытой подложки Мо глубина окисления превысила 12 мкм. В действительности это значение составило ~1 мм, учитывая разницу в размерах образца до и после отжига (рис. 11а). В случае покрытия Mo-Zr-Si-B + 2Y HIPIMS (рис. 11б), на поверхности после отжига образовался оксидный слой 6 мкм. На глубине 6-10 мкм сохранилось равномерное распределение компонентов покрытия. Диффузия материала подложки в покрытие не наблюдалась. В случае непокрытой подложки атомы кислорода диффундируют вглубь материала на значительную глубину (рис. 11б). При нанесении защитного покрытия глубина проникновения кислорода ограничена толщиной оксидной поверхностной пленки.



**Рис. 11.** Удельная потеря массы для непокрытой Мо-подложки и покрытий, внешний вид образцов до и после отжигов (верхний и нижний ряд, соответственно) (а), элементные профили непокрытой Мо-подложки и покрытия Мо–Zr– Si–B + 2Y HIPIMS после отжига при 1000°С (пунктирные и сплошные линии, соответственно) (б).



**Рис. 12.** Светлопольные изображения структуры и электронограммы покрытия Mo–Si–B + 4Y DCMS при температурах 20–1000°С.

Для иттрий-содержащего покрытия Mo–Si– В + 4Y DCMS было проведено исследование структурно-фазовых превращений, происходящих при нагреве ламели покрытия в колонне ПЭМ до 1000°С. На рис. 12 приведены светлопольные изображения структуры и электронограммы покрытия при температурах 20-1000°С. Нагрев до 600°С не приводил к изменениям: на-



**Рис. 13.** РЭМ изображения поверхности покрытий Mo-Si-B DCMS и Mo-Si-B + 4Y DCMS после отжигов при температуре  $800^{\circ}$ C.

нокомпозитная структура покрытия сохранялась, межплоскостные расстояния для фаз t-MoB (d/n = 0.305 нм) и *h*-MoSi<sub>2</sub> (d/n = 0.222 нм) были аналогичны исходному состоянию. Средний размер кристаллитов гексагональной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub>, определенный по светлопольным изображениям структуры, возрастал с 2.8 до 3.3 нм при увеличении температуры с 20 до 800°С. При 800°С на электронограммах помимо фаз t-MoB и h-MoSi<sub>2</sub> c теми же межплоскостные расстояниями, обнаруживался новый рефлекс, соответствующий тетрагональной фазе *t*-MoSi<sub>2</sub> (d/n = 0.196 нм). Увеличение температуры до 1000°С привело к сужению рефлексов h-MoSi2 и t-MoSi2 и появлению новых отражений: от фаз t-Mo<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> (d/n = 0.342 нм) и t-МоВ (d/n = 0.305 нм). Размер кристаллитов не превышал 20 нм. Таким образом, при нагреве покрытия Mo-Si-B + 4Y DCMS до 800°С наблюдается фазовый переход h-MoSi<sub>2</sub>  $\rightarrow$  t-MoSi<sub>2</sub>, при 1000°С дополнительно формируется фаза *t*-Mo<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>. Важно отметить, что присутствующие в исходном состоянии гексагональная h-MoSi<sub>2</sub> и тетрагональная *t*-MoB фазы сохраняются при нагреве до 1000°C.

Микрофотографии поверхности покрытий Mo-Si-B DCMS и Mo-Si-B + 4Y DCMS после отжигов при температуре 800°С представлены на рис. 13. Покрытие Mo-Si-B DCMS растрескивается при данной температуре: на поверхности наблюдается сетка трещин, ширина которых составляет около 100 нм. В случае легированного Y покрытия Mo-Si-B + 4Y DCMS трещин и других поверхностных дефектов не обнаружено. При 1000°С выявленная структура покрытий сохранялась. Таким образом, добавка иттрия подавляет образование и распространение трещин при термическом воздействии в результате модификации структуры покрытия Mo-Si-B DCMS по аналогии с [9].

# выводы

Покрытия в системе Mo–Y–Zr–Si–B были получены методом магнетронного напыления в режимах DCMS и HIPIMS с использованием мишеней MoSi<sub>2</sub> + 10% MoB и (MoSi<sub>2</sub> + 10% MoB) + + 20% ZrB<sub>2</sub>, в зоне эрозии которых располагались сегменты металлического иттрия. Покрытия характеризовались низкой концентрацией дефектов и равномерным распределением элементов по толщине. Основной структурной составляющей покрытий являлась фаза *h*-MoSi<sub>2</sub>. Легирование иттрием и переход от DCMS к режиму HIP-IMS способствовали снижению размера кристаллитов основной фазы *h*-MoSi<sub>2</sub> с 30–100 до 2–4 нм, а также повышению доли аморфной составляющей.

Покрытие Mo–Si–В DCMS обладало твердостью 23 ГПа, модулем упругости 320 ГПа и упругим восстановлением 46%. Легирование иттрием приводит к снижению механических характеристик покрытий Mo–Si–В. В то же время, переход от режима DCMS к HIPIMS способствует росту твердости и модуля упругости на ~10%. Введение иттрия в состав покрытий Mo–Si–В и переход к режиму HIPIMS способствовали повышению адгезионной прочности и трещиностойкости покрытий.

Введение Y в состав покрытий Mo–Si–В приводит к снижению износостойкости в условиях абразивных и циклических ударных воздействий. Однако для иттрий-содержащих образцов переход от режима DCMS к HIPIMS позволил повысить этот показатель на 20 и 60%, соответственно. Наиболее эффективном явилось комбинированное легирование покрытий Zr и Y, обеспечившее двухкратное повышение абразивной стойкости покрытий Mo–Si–B.

Нанесение покрытий Mo–Si–B и Mo–Y–Zr– Si–B позволило повысить жаростойкость молибденового сплава при температуре 1000°С в 3 и 9 раз, соответственно. Отжиги в вакуумной печи, а также нагрев ламелей образцов в колонне просвечивающего электронного микроскопа показали, что введение Y в состав покрытий Mo–Si–B подавляет образование трещин при высокотемпературном нагреве и способствует повышению термической стабильности покрытий до 1000°C.

## БЛАГОДАРНОСТИ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 23-49-00141). Р. Feng выражает благодарность за финансовую поддержку фонду NSFC (проект № 5221101774).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Perepezko J.H. // Science. 2009. V. 326. P. 1068-1069.
- Su Ranran, Liu Longfei, Perepezko John H. // International J. Refractory Metals and Hard Materials. 2023. V. 113. P. 106199.
- Zhu L., Zhu Y., Ren X., Zhang P., Qiao J., Feng P. // Surface and Coatings Technology. 2019. V. 375. P. 773–781.
- 4. Fu T., Zhang Y., Shen F., Cui K., Chen L. // Materials Characterization. 2022. V. 192. P. 112192.
- Wei Li, Jinglian Fan, Yan Fan, Lairong Xiao, Huichao Cheng // J. Alloys and Compounds. 2018. V. 740. P. 711–718.
- Yanagihara K., Przybylski K., Maruyama T. // Oxidation of Metals. 1997. V. 47. P. 277–293.
- Kiryukhantsev-Korneev P.V. et al. // Russian J. Non-Ferrous Metals. V. 55 № 6. P. 645–651. https://doi.org/10.3103/S106782121406011X
- Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Iatsyuk I.V., Shvindina N.V., Levashov E.A., Shtansky D.V. // Corrosion Science. 2017. V. 123. P. 319–327.
- 9. Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sytchenko A.D., Sviridova T.A., Sidorenko D.A., Andreev N.V., Klechkovskaya V.V., Polčak J., Levashov E.A. // Surface and Coatings Technology. 2022. V. 442. P. 128141.
- 10. *Won June Choi et al.* // International J. Refractory Metals and Hard Materials. 2019. V. 80. P. 238–242,
- Zilong Wu, Kanglu Feng, Jiangbo Sha, Chungen Zhou // Progress in Natural Science: Materials International. 2022. V. 32. № 6. P. 752–757.
- Kiryukhantsev-Korneev F.V., Sytchenko A.D., Vakhrushev R.A. et al. // Phys. Atom. Nuclei. 2022. V. 85. P. 2088–2091.
- 13. Zhestkova B.E., Terent'eva V.S. // Russian Metallurgy (Metally). 2010. V. 1. P. 33–40.
- 14. Pang J., Blackwood D.J. // Corr. Sci. 2016. V. 105. P. 17–24.
- 15. *Totemeier T.C., Wright R.N., Swank W.D.* // Intermetallics. 2004. V. 12. № 12. P. 1335–1344.
- Zhang Y., Li H., Ren J., Li K. // Corr. Sci. 2013. V. 72. P. 150–155.
- Kuznetsov S.A., Rebrov E.V., Mies M.J.M., de Croon M.H.J.M., Schouten J.C. // Surf. Coat. Technol. 2006. V. 201. P. 971–978.
- Kudryashov A.E et al. // Surf. Coat. Technol. 2018. V. 335. P. 104–117.
- Zhu L., Chen P., Cai Z., Feng P., Kang X., Akhtar F., Wang X. // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2022. V. 32. № 3. P. 935–946.
- Lange A., Heilmaier M., Sossamann T.A., Perepezko J.H. // Surface and Coatings Technology. 2015. V. 266. P. 57–63.

- 21. Perepezko J.H., Sossaman T.A., Taylor M. // J. Them. Spray Tech. 2017. V. 26. P. 929–940.
- Ritt P., Sakidja R., Perepezko J.H. // Surf. Coat. Technol. 2012. V. 206. P. 4166–4172.
- Shtansky D.V. et al. // Surface and Coatings Technology. 2012. V. 208. P. 14–23.
- 24. *Kukla R.* // Surf. Coat. Technol. 1997. V. 93. № 1. P. 1–6.
- 25. Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Horwat D., Pierson J.F., Levashov E.A. // Tech. Phys. Lett. 2014. V. 40. P. 614–617.
- Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sheveyko A.N., Vorotilo S.A., Levashov E.A. // Ceramics International. 2020. V. 46. № 2. P. 1775–1783.
- Helmersson U., Lattemann M., Bohlmark J., Ehiasarian A.P., Gudmundsson J.T. // Thin Solid Films. 2006. V. 513. P. 1–24.
- Xie Dong, Wei L.J., Liu H.Y., Zhang K., Leng Y.X., Matthews D.T.A., Ganesan R., Su Y.Y. // Surf. Coat. Technol. 2022. V. 442. 128192.
- Lattemann M., Ehiasarian A.P., Bohlmark J., Persson P.Å.O., Helmersson U. // Surf. Coat. Technol. 2006. V. 200. P. 6495–6499.
- Kiryukhantsev-Korneev F.V. // Russ. J. Non-ferrous Metals. 2014. V. 55. P. 494–504. https://doi.org/10.3103/S1067821214050137
- 31. Veprek S. et al. // Thin Solid Films. 2005. V. 476. P. 1–29.
- 32. *Fischer-Cripps A.C. et al.* // Surface and Coatings Technology. 2006. V. 200. P. 5645–5654.
- Zawischa M., Azri M.M., Supian B.M., Makowski S., Schaller F., Weihnacht V. // Surf. Coat. Technol. 2021. V. 415. P. 127118.
- 34. Musil J. // Research signpost. 2008. P. 1-35.
- Shtansky D.V. et al. // Phys. Solid State. 2006. V. 48. P. 1301–1308.
- Tayebi N., Polycarpou A.A., Conry T.F. // J. Materials Research. 2004. V. 19. P. 1791–1802. https://doi.org/10.1557/JMR.2004.0233
- Li J., Beres W. // Canadian Metallurgical Quarterly. 2007. V. 46:2. P. 155–173. https://doi.org/10.1179/cmq.2007.46.2.155
- 38. *Kiryukhantsev-Korneev P.V., Sheveiko A.N., Petrzhik M.I. //* Prot Met Phys Chem Surf. 2019. V. 55. P. 502–510.
- Schwarzer N., Duong Q.-H., Bierwisch N., Favaro G., Fuchs M., Kempe P., Widrig B., Ramm J. // Surface and Coatings Technology. 2011. V. 206(6). P. 1327–1335. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2011.08.051
- 40. Leyland A., Matthews A. // Wear. 2000. V. 246. P. 1.
- 41. Mustafa M.M.B., Umehara N., Tokoroyama T., Murashima M., Shibata A., Utsumi Y., Moriguchi H. // Tribology Online. 2019. V. 14. № 5. P. 388–397.
- 42. Kiryukhantsev-Korneev P.V., Pierson J.F., Bychkova M.Y. et al. // Tribol. Lett. 2016. V. 63. P. 44.
- 43. *Chen J., Bull S.* // J. Physics D: Applied Physics. 2011. V. 44(3). P. 34001.
- Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sytchenko A.D., Potanin A.Yu., Vorotilo S.A., Levashov E.A. // Surf. Coat. Technol. 2020. V. 403. P. 126373.
- 45. *Beake B.D.* // Surface and Coatings Technology. 2022. V. 442. P. 128272.
  - https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128272
- 46. McMaster S.J., Kosarieh S., Liskiewicz T.W., Neville A., Beake B.D. // Tribology International. 2023. V. 185. P. 108524. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2023.108524